

請求の範囲

- [請求項1] 砥粒と、液状媒体と、を含有するスラリーであって、
前記砥粒が、第1の粒子と、当該第1の粒子に接触した第2の粒子と、を含み、
前記第1の粒子がセリウム酸化物を含有し、
前記第2の粒子がセリウム化合物を含有し、
下記式(1)により算出されるR s p値が1.60以上である、スラリー。
$$R s p = (T b / T a v) - 1 \quad (1)$$

[式中、T a vは、前記砥粒の含有量が2.0質量%である場合において前記スラリーのパルスNMR測定により得られる緩和時間(単位：m s)を示し、T bは、前記砥粒の含有量が2.0質量%である場合において前記スラリーを遠心加速度 2.36×10^5 Gで50分間遠心分離したときに得られる上澄み液のパルスNMR測定により得られる緩和時間(単位：m s)を示す。]
- [請求項2] 前記セリウム化合物がセリウム水酸化物を含む、請求項1に記載のスラリー。
- [請求項3] 前記砥粒の平均粒径が16～1050nmである、請求項1又は2に記載のスラリー。
- [請求項4] 前記砥粒の含有量が0.01～10質量%である、請求項1～3のいずれか一項に記載のスラリー。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか一項に記載のスラリーをろ過する工程を備える、研磨液の製造方法。
- [請求項6] 請求項5に記載の研磨液の製造方法により得られた研磨液を用いて被研磨面を研磨する工程を備える、研磨方法。
- [請求項7] 前記被研磨面が酸化珪素を含む、請求項6に記載の研磨方法。